

請求の範囲

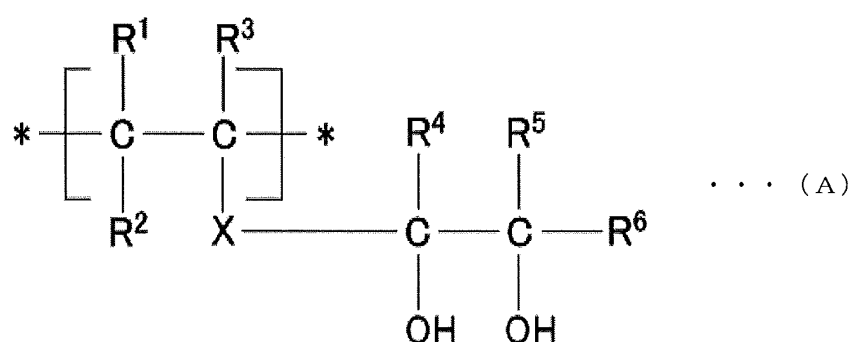
[請求項1]

砥粒と、

塩基性化合物と、

下記一般式（A）で表される1，2－ジオール構造単位を有するビニルアルコール系樹脂にビニルピロリドンが重合した共重合体である水溶性高分子とを含む、研磨用組成物。

[化1]



但し、 R^1 、 R^2 、及び R^3 はそれぞれ独立して水素原子又は有機基を示し、 X は単結合又は結合鎖を示し、 R^4 、 R^5 、及び R^6 はそれぞれ独立して水素原子又は有機基を示す。

[請求項2]

請求項1に記載の研磨用組成物であって、

前記水溶性高分子は、1，2－ジオール構造単位を有するビニルアルコール系樹脂にビニルピロリドンがグラフト重合したグラフト共重合体であり、前記1，2－ジオール構造単位を有するビニルアルコール系樹脂の重合度が200～800であり、25℃で測定した4％水溶液の粘度が11 mPa・s以下である、研磨用組成物。

[請求項3]

請求項2に記載の研磨用組成物であって、

前記粘度が9 mPa・s以下である、研磨用組成物。

[請求項4]

請求項1～3のいずれか一項に記載の研磨用組成物であって、

前記塩基性化合物は、アルカリ金属酸化物、アルカリ金属塩、アンモニア、アミン、アンモニウム塩、及び第四級アンモニウム水酸化物

類からなる群から選択される 1 種以上である、研磨用組成物。

[請求項5] 請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の研磨用組成物であって、
非イオン性界面活性剤をさらに含む、研磨用組成物。

[請求項6] 請求項 1 ～ 5 のいずれか一項に記載の研磨用組成物であって、
前記研磨用組成物は、シリコンウェーハの研磨に用いられる、研磨
用組成物。

[請求項7] 請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の研磨用組成物を用いてシリコ
ンウェーハを研磨することを含む、シリコンウェーハの研磨方法。